レーザー同期短バンチ陽電子ビーム装置の開発

 神野 和哉¹⁾、誉田 義英、田代 睦、山口 倫宏、磯山 悟朗、田川 精一 大阪大学産業科学研究所
〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

概要

レーザーを用いてポジトロニウムを直接励起させることにより、物質中におけるポジトロニウムの挙動を調べる実験を計画している。このような実験においては、高密度短バンチ陽電子ビームが必要である為、高密度シングルバンチビームが発生可能なLバンド電子ライナックを用いた新しい装置を設計した。この装置によって生成される陽電子ビームを数値的に評価した結果、バンチあたりの陽電子数は約1.1×10⁵個、パルス幅は 200 ps であることがわかった。

1. はじめに

物質中に入射した陽電子は、主に電子との非弾性 散乱により急速にエネルギーを失う。そして、イオ ン化ポテンシャル以下(~10eV)までエネルギーを失 うと、エキシトンの生成やフォノン励起などにより、 熱エネルギー程度(kT~0.03eV)まで減速すると考えら れている。このようにして減速された陽電子は、短 い時間の間に物質中の周辺電子と対消滅する。しか し、欠陥やボイドなど電子密度の薄い部分があると 選択的にそこに入り込み、結果的に寿命は延びる。 高分子のような自由体積の大きな物質においては、 ポジトロニウム(Ps)という電子と陽電子が対になっ て結合した水素原子型の束縛状態ができ、自由体積 中にトラップされることが知られている。この内、 構成要素の電子と陽電子のスピンが平行なオルソポ ジトロニウム(o-Ps)の寿命は自由体積の大きさに依 存する。その為、高分子などの自由体積の評価に陽 電子寿命測定が用いられている。しかし、o-Ps の寿 命を決定する要因には他にも様々な相互作用が介在 している。ここでは、物質中でのo-Ps状態を評価し、 寿命との関係を調べることを目的としている。一般 に、基底状態にある o-Ps に比べて励起状態にある o-Ps の方が、周辺のポテンシャルの違いによる影響 を受けやすい。その為、o-Ps の励起状態を調べるこ とにより、自由体積内部のポテンシャルの影響まで 含めた情報を得られる可能性がある。そこで、陽電 子バンチに同期した短パルスレーザーを照射し、物 質中の o-Ps に励起を引き起こさせ、レーザーの吸収 スペクトルを調べることを計画している。また、レ ーザー照射のタイミングをシステマッティックに変 化させることにより、Ps の生成される時間について も知見を得ることができる可能性がある。現在、阪



図1:測定系のブロックダイアグラム

大産研放射線実験所では、Sバンド電子ライナックを 用いて、低速陽電子ビームを生成している^[1]。しか し、それを用いた装置では、バンチあたりの陽電子 数が非常に少ない為 S/N が低く、この実験には不向 きである。阪大産研放射線実験所にはもう一台 Lバ ンド電子ライナックがある。こちらには、サブハー モニックプリバンチャー(SHPB)が装備されており、 高電荷密度のシングルバンチを発生させることがで きる。このライナックの最大エネルギーは 38 MeV で あり、1パルスあたりの電荷量は 91 nc、繰り返し 120 pps、パルス幅約 20 ps である。このライナックから の短バンチ電子ビームをコンバーターに当て陽電子 を生成する。そして、モデレーターを用いずに、そ のまま低エネルギー成分を実験室に導くことにした。 このブロックダイアグラムを図1に示す。

2. 偏向電磁石から陽電子発生部までの電 子ビームの輸送系の配置

L バンドライナック下流の偏向電磁石と壁との間 隔は、図2に示してあるように、約4m程度である。

¹ E-mail: kanno25@sanken.osaka-u.ac.jp



図2:装置配置

この間隔に四極電磁石と陽電子発生部を設置し、 コンバーターにはできるだけ小さいビーム径で入射 しなければならない。

この実験においてライナックは 28 MeV で運転される。その時の電子ビームのエミッタンスを約 5π mm·mrad として転送行列を用いて電子の軌道を計算し、コンバーター上でのx方向とy方向の径のrmsを最小にするようにシンプレックス法^[2]を用いて最適化を行った。トリプレットの QM のみの場合で計算した結果、使用予定の QM の電流許容値を超える為、トリプレットの QM と併せてシングレットの QM も設置した場合について評価した。この場合、この系において最適な QM の電流値と QM と発生部の配置の組合せが見つかった。輸送系の配置を図3、そのときの電子ビームの位相空間での様子を図4にそれぞれ示す。



図3:ビームライン



図4:電子ビームの位相空間での様子

左から右までのグラフはそれぞれ、BMの出口、4つのQMの入口と出口、コンバーター上での様子を順番に表している。

3. 陽電子発生部の設計

コンバーター後端から発生する低速陽電子量は EGS4 コード^[3]を用いて評価した。コンバーターの材 質は、タングステンを用いることにした。このシミ ュレーションコードでの電子、陽電子のカットオフ エネルギーは、10 keV である為、コンバーター内で 発生した陽電子が10 keV 以下になる場所を求めた。 ここから更に熱化するまで移動するが、A. P. Mills, Jr. and R. Wilson^[4]によって、それはせいぜい 100 nm 程 度であることがわかっている。これは拡散距離に比 べて非常に短い為、この差は考慮しない。利用可能 陽電子は、コンバーター後端から約 1 µm 以内に限 られる為、異なるコンバーター長に対し、この部分 で10keV以下になる陽電子量を入射電子数で割った 値を生成効率と定義し、表1に示す。これから、コ ンバーターの最適な長さは4mmで、その時の変換効 率は(2.8±0.6)×10⁻⁶であることがわかる。更に、電 子や陽電子の高エネルギー成分、γ線などを再利用 し、生成効率を上げる為、リフレクターを設置した 場合について評価した結果を表2に示す。

表1: コンバーターの厚さと生成効率の関係

Converter thickness	Efficiency		
(mm)	$(\times 10^{-6})$		
1	0.8 ± 0.3		
2	2.4 ± 0.5		
3	2.8 ± 0.8		
4	2.8 ± 0.6		
5	2.8 ± 0.8		
6	1.8 ± 0.6		

表2:リフレクターを設置した場合の変換効率

(コンバーターの厚さは4mm)				$\times 10^{-6}$			
		Reflector thickness (mm)					
		0.1	1	2	3	4	
Gap (mm)	1		4.7±0.9	3.6±1.2			
	2	2.8±1.0	6.4±1.6	48±1.4	2.4±1.0		
	3		6.4±1.1	6.0 ± 1.1	7.7±1.6	6.2±1.1	
	4		5.2±1.0	40±1.4			

この場合、最適なリフレクターの厚さは 3 mm、コ ンバーターとの間隔は3 mm であり、その時の変換 効率は(7.7±1.6)×10⁻⁶ であることがわかる。ここで、 陽電子発生部の設計図を図5に示す。

次に、生成陽電子の引き出し効率とパルス幅を評 価した。簡単の為、陽電子のタングステンに対する 拡散係数を 1.5 cm²/s、及び消滅時間を 150 ps と仮定 し、1次元の拡散のみを考慮した。この結果、1 µm の領域に含まれている陽電子の約 4.5 %が後端表面 に到達することがわかった。また、図6に示してい るように、このうちの約94%が100ps以内に到達し、 99%が200ps以内に到達していることがわかる。従 って、電子からコンバーター後端に到達する陽電子 への変換効率は、3.5×10⁻⁷となる。コンバーターに 入射する電子の数は、約3×10¹¹個である為、結局、 約 1.1×10³ 個の陽電子が得られることになる。この



図5:陽電子発生部



図6:引き出し効率と時間の関係

陽電子のパルス幅は陽電子輸送中でも拡がる為、2 回曲げるだけで実験室に導くことにした。パルス幅 の拡がりはビーム径や輸送エネルギーにも依存して いる。例えば、入射電子のビーム径が10mmのとき、 100 keV 、1 keV、10 keV に対し、陽電子のパルス幅 は、それぞれ 68 ps 、26 ps、4 ps となり、輸送エネ ルギーは高いほど有利である。また、径が2倍にな ると、パルス幅は2倍以上になる為、ビーム系はで きるだけ小さいことが望まれる。一方、コンバータ ーから輸送されてくる陽電子は熱化しきらずに放出 されてくるものも存在する為、エネルギーの分布は 非常に幅広くなり、低速成分だけを取り出す為には、 曲部で電子、及び陽電子の高エネルギー成分を、よ りドリフトさせ、アパーチャーや2個1組のコリメ ーターを軸上から外れた位置に設置することで、こ れらの粒子を切り捨てなければならず、この為にも、 ある程度輸送エネルギーを上げる必要がある。

4. まとめ

物質中での o-Ps の状態を調べる目的で、高密度シ ングルバンチビームが発生可能な L バンド電子ライ ナックを用いた新しい装置を設計した。この装置に よって生成される陽電子ビームを評価した結果、200 ps 以内に約 1.1×10⁵の陽電子パルスが得られること が可能であることがわかった。

参考文献

- [1] M. Tashiro, et al., Proceedings of the 26th linear Accelerator Meeting in Japan, Tukuba, August 1-3, 2001,
- pp.309-310. William H. Press, et al., "Numerical Recipes in Fortran" [2]
- W. R. Nelson, H. Hirayama and D. W. O. Rogers., [3] SLAC-265,December 1985". [4] A. P. Mills, et al., "Phys. Rev. A26 (1982), p490".